

2025 年 7 月 4 日
株式会社フジインコーポレーテッド

第 73 期定時株主総会における質疑応答(要旨)

2025 年 6 月 24 日(火)に開催いたしました当社第 73 期定時株主総会における質疑応答の要旨は以下のとおりです。

質問

当社は、女性活躍推進にも取り組んでおり、社外取締役 4 名のうち 2 名が女性で、多様性の点から大変良いことであるが、今後は当社従業員から社内取締役への女性登用が進むことを期待している。また、年功序列の時代ではないと思うので、役員の若返り、若い世代の活躍を期待したい。加えて、連結配当性向 30%台の企業もある中、当社は 55%以上を掲げている。今後も企業努力として、60%台、70%台と増加していくことも検討願いたい。

回答者

代表取締役社長 関 敬史(議長)

回答

当社は、従業員全体の 80%程が男性であり、女性比率は低いものの近年は監督職である主任級・係長級が増加しており、女性全体の 20%程度を占めている。管理職としては、課長級の女性が当社に 4 名いるが、海外子会社を含むグループ全体では、既に役員クラスの者もいる。若い世代の活躍や連結配当性向の増加についてはご意見として承らせていただきたいが、当社としては女性活躍推進に加え、こうした海外子会社からの役員級登用がなされるような取り組みも継続して進め、企業価値の増大、株主様への還元にもつなげてまいりたい。

質問

米国の関税政策により、当社の業績や活動にどのような影響があるのか。また、中国の輸出規制により、レアアース等が入手しづらい状況となっているがどのように確保を行っているかお聞かせ願いたい。

回答者

常務取締役 鈴木 勝弘

回答

当社における米国の関税政策の主な影響は、日本から米国子会社であるフジコーポレーションへ輸出する製品及び原材料、並びにフジコーポレーションから輸出する製品、特に中国に輸出する製品に対する関税である。お客様毎に現状及び今後予測される状況、影響度の説明等を行い、価格に転嫁させていただけるよう交渉を続けている。

回答者

常務取締役 大脇 寿樹

回答

当社におけるレアアースの確保については、中国のレアアース等の輸出規制に対し、即座に中国当局へ輸出許可申請を行い、一部については輸出許可を得ている。併せて、原材料の安定調達に向け、代替可能な原材料の探索も進めており、代替の原材料については、お客様より認定をいただけるよう活動を行っている。

質問

売上高が前期比で 21.5%増となっているが、製品の販売量増によるものなのか、コスト増等に伴う価格転嫁に起因する販売価格上昇によるものなのかをお聞かせ願いたい。また、セグメント別経営成績において、北米のセグメント利益の割合が他の地域に比べて小さい理由をお聞かせ願いたい。

回答者

代表取締役社長 関 敬史(議長)

回答

売上高については、前期(2024 年 3 月期)比で約 110 億円増となっているが、販売量の伸びによるところが大部分。加えて、数年前より続く原材料価格の高騰に伴うお客様との価格転嫁の交渉が妥決したことによる増を一部含んでいる。販売量の伸びの背景としては、お客様側の立ち上げから間もなく、比較的単価が高い 5nm、3nm 等の先端半導体向け製品の販売が好調に推移していることが挙げられる。

また、北米のセグメント利益が他の地域に比べて小さい理由としては、米国における人件費増が挙げられる。米国においては、フジミコーポレーションを起点に、日本国内で生産された製品の輸入・販売に加え、現地で生産した製品の販売を展開しているが、いずれにおいても、主要なお客様の業績状況等によるもののほか、人件費増が近年の課題となっている。米国におけるインフレ率を上回る賃金の増加は、働く人にとっては働きやすい環境につながる一方、米国でものづくりをする企業にとっては大きな悩みと考えており、米国に子会社を持つ当社においても課題の一つである。

質問

当社は IR 活動に非常に積極的で、株主対応も細やかと感じる。一方で、株価は人気商売的な部分があり、テレビや新聞等のメディア露出、YouTube 等の積極的な活用により、株価の上昇にもつながるのでは、と考えている。世の中や投資家の期待が高まるような、株価を意識した経営・施策の実施をお願いしたい。

回答者

代表取締役社長 関 敬史(議長)

回答

当社の状況を世の中に発信することは非常に重要と考える。その手段の 1 つが IR 活動と考えており、当社としても、証券取引所や企業が主催する IR イベントにも積極的に参加している。一方で、対外的な PR 活動については非常に悩ましく感じている。製品販売の点においては、当社は BtoB ビジネスを行う企業である為、例えば、高額な広告宣伝費をかけて CM 放映を行っても直接販売につながるとは考えづらく、費用に対する効果が見えづらいというジレンマがある。しかしながら、リクルートの点においては、競争の激しい採用市場を勝ち抜く為にも重要と考えるが、費用のかけ方については、将来に向けた積極的な投資、事業育成に向けた開発も続けていることから、優先順位を慎重に検討のうえ、発信してまいりたい。

質問

本年度の設備投資、また資金調達はどのような計画か、お聞かせ願いたい。

回答者

代表取締役社長 関 敬史(議長)

回答

6年間で累計550億円の設備投資を計画している中長期経営計画では、毎年約30億円の既存工場・開発拠点における設備増強の投資ほか、国内においては、各務原市に半導体デバイス向けCMP製品の生産を中心とした新工場の建設、また第2開発センター(仮称)の建設を進めている。新工場は、2025年末に竣工し、お客様の認定を経て、2027年以降の生産・販売開始、第2開発センターは、2026年以降の竣工を予定している。海外においても、米国、台湾等における生産能力向上を進めており、本年度は約296億円の設備投資を予定している。

資金調達は、現預金と毎年のキャッシュフローから充当することを原則としているが、こうした当社の次世代を支える大型投資において前倒しで資金が必要となってくる局面では、外部からの借入を組合せていく必要があると考える。借入については、本日開示となる有価証券報告書に、重要な後発事象として掲載している為、ご確認願いたい。

質問

営業利益の変動要因について、滝グラフ(ウォーターフォールチャート)等を用いて示していただきたい。また、当社の中長期経営計画の設備投資について、投資分野をお聞かせ願いたい。

回答者

代表取締役社長 関 敬史(議長)

回答

営業利益の増減要因を分析したウォーターフォールチャート及び設備投資に関する資料は、毎年5月に実施する機関投資家向け決算説明会資料として、当社ウェブサイトにも掲載している為、ご確認願いたい。(※以下、2025年3月期決算説明会資料を投影し説明)

営業利益は、2024年3月期実績の82.5億円に対して、2025年3月期は117.8億円となり、35.2億円の増加となった。営業利益増加の主な要因は生産・販売量増の59.4億円、減少の主な要因は経費増の11.5億円、人件費増の10.9億円等である。

また、次期予想としては、2025年3月期実績の117.8億円に対して、2026年3月期は121億円となり、3.2億円の増加を予想している。営業利益増加の主な要因は生産・販売量増の14.9億円、減少の主な要因は償却費増の6.9億円、人件費増の5億円等である。

また、設備投資の投資分野についても決算説明会の都度アップデートをしている。国内外の半導体デバイスメーカーにおいて投資計画が公表され、建設が進む中、当社主力製品であるCMP製品の生産能力が3～5年後には不足することが予想される。お客様への製品供給途絶を回避するため、日本、米国、台湾の拠点に対し投資を行っている。また、中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資として、2025年5月に着工した第2開発センターへの投資を行っている。

本資料の内容については不明瞭な点もあるかもしれないが、機密情報が含まれることから、本資料以上の内容を開示出来ないことをご理解いただきたい。

以 上

中期的な設備投資計画

2022年6月 2022年3月期決算説明会資料再掲

- ・ 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- ・ 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

各務山新工場建設（計画）

敷地面積：28千㎡

’21年12月に売買契約を締結

- ・ シリコン、CMP製品の生産能力増強

FUJIMI CORPORATION（米国）

既存工場敷地内に新棟建設を計画

- ・ CMP生産スペース拡大

FUJIMI TAIWAN（台湾）

- ・ 建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画

- ・ 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

第2開発センター（仮称）建設（計画）

敷地面積：16千㎡

現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済

- ・ 非半導体関連の研究施設を設置



中期的な設備投資計画（アップデート）

2024年11月 2025年3月期第2四半期決算説明会資料再掲

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

計画概要	現状（スケジュール）	将来計画
各務山新工場建設 敷地面積：28千㎡ '21年12月に売買契約を締結 ・シリコン、CMP製品生産能力増強	'24年10月 着工 '25年末 竣工 '26年中 試作品出荷 '27年中 本格生産開始	【Phase2】顧客需要を見ながら、しかるべきタイミングで新工場内に生産ライン増設 【Phase3】2030年以降の需要に備え、当上期に新工場隣接の工場用地(34千㎡)を取得済
FUJIMI CORPORATION（米国） 既存工場敷地内に新棟建設を計画 ・CMP製品生産スペース拡大 ・SiC用製品	新棟建設計画を既存建屋内空きスペースの生産ライン増強に切替（工期長期化懸念に備え） '25年末 設備設置完了	2030年以降の需要に備え、敷地内（又は新たに取得した土地）に新工場棟を建設
FUJIMI TAIWAN（台湾） ・建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画	'25年末 導入完了 '26年 生産開始	2030年以降の需要に備え、新たな工場用地の検討を当下期に開始予定

- 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

第2開発センター(仮称)建設 敷地面積：16千㎡ 現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済 ・非半導体関連の研究施設を設置	'25年5月着工に向けて予定通り進捗（詳細設計中）
--	----------------------------------

中期的な設備投資計画（アップデート）

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

計画概要	現状（スケジュール）	将来計画
各務山新工場建設 敷地面積：28千㎡ ’21年12月に売買契約を締結 シリコン、CMP製品生産能力増強	’24年10月 着工 ’25年末 竣工 ’26年中 試作品出荷 ’27年中 本格生産開始	【Phase2】顧客需要を見ながら、しかるべきタイミングで新工場内に生産ライン増設 【Phase3】2030年以降の需要に備え、当上期に新工場隣接の工場用地(34千㎡)を取得済
FUJIMI CORPORATION（米国） 既存工場敷地内に新棟建設を計画 - CMP製品生産スペース拡大 - SiC用製品	新棟建設計画を既存建屋内空きスペースの生産ライン増強に切替（工期長期化懸念に備え） ’25年末 設備設置完了	2030年以降の需要に備え、敷地内（又は新たに取得した土地）に新工場棟を建設
FUJIMI TAIWAN（台湾） 建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画	’25年末 導入完了 ’26年 生産開始	2030年以降の需要に備え、新たな工場用地の検討を開始

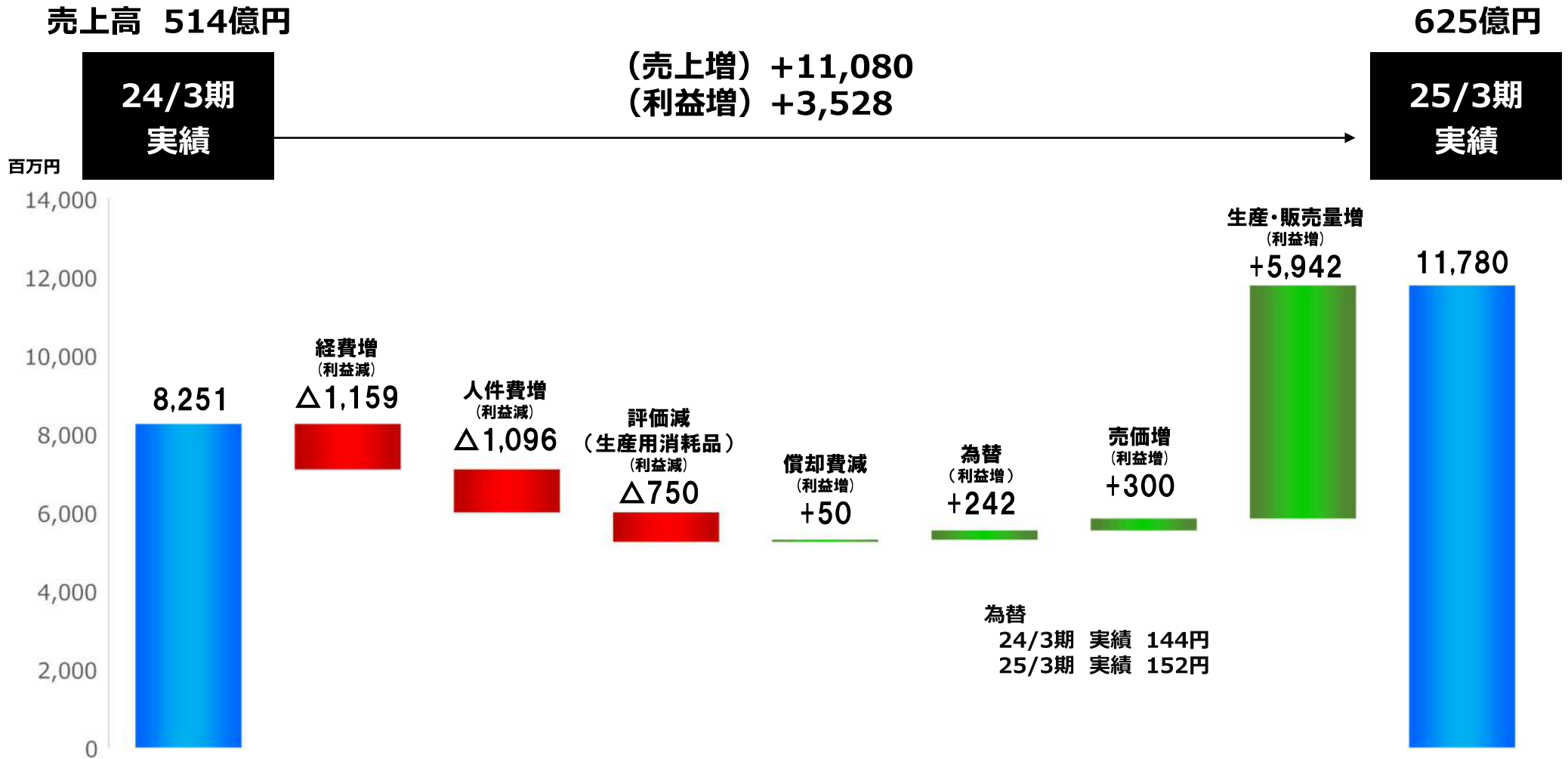
- 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

第2開発センター(仮称)建設 敷地面積：16千㎡ 現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済 非半導体関連の研究施設を設置

’25年5月 着工 ’26年10月 竣工 完成予想図→
--



営業利益増減要因 24/3期実績 → 25/3期実績



営業利益増減要因 25/3期通期実績 → 26/3期通期予想

